

Deutsche und chinesische Gebrauchsmuster

Die gefährlichsten IP-Waffen in Angriff und Verteidigung

DIE THEMEN

- Gebrauchsmusterverletzungsverfahren:
der effizientere Patentverletzungsprozess?
- Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsprozess:
wie kann man das Zusammenspiel optimal nutzen?
- Gebrauchsmuster und einstweilige Verfügung
- Abzweigung aus PCT/EP-Anmeldungen:
welche Optionen bietet der (neue) Offenbarungsbegriff des BGH?
- Lösungsverfahren: Überraschungen vermeiden

Gebrauchsmuster in
China: Worauf man sich
einstellen muss
und wie man dieses
Instrument für eigene
Zwecke nutzen kann

IHRE REFERENTEN

Dr. Matthias Zigann

Vorsitzender Richter,
Landgericht München I,
7. Zivilkammer,
München

Dr. Tobias Wuttke

Partner/Fachanwalt für
Gewerblichen Rechtsschutz,
Meissner Bolte,
München

Dr. Oliver Pfaffenzeller

Lead IP Counsel,
Siemens AG,
München

Ziel des Seminars

Dieses Seminar vermittelt Ihnen, wie Sie das deutsche und chinesische Gebrauchsmustersystem strategisch maximal effizient einsetzen können.

Das notwendige Wissen wird anhand einer Vielzahl von Case Studies vermittelt, die alle tatsächlichen Fällen aus der Praxis nachgebildet sind. Zugleich erhalten Sie einen aktuellen Überblick über die zentralen Entwicklungen der Rechtsprechung zu Offenbarung, Schutzfähigkeit und Schutzbereich.

Durch die Bezugnahme auf das chinesische Gebrauchsmustersystem wird eine globale Perspektive vermittelt, da das Gebrauchsmusterrecht in Deutschland und China die im internationalen Vergleich mit Abstand größte Rolle spielt.

Teilnehmerkreis

Sie sind als Mitarbeiter einer Rechts-, IP-, Patent- oder F&E-Abteilung zuständig bei Verletzungen technischer Schutzrechte und möchten Ihr Arsenal um eine weitere IP-Waffe ergänzen? Oder beraten Sie als Rechtsanwalt oder Patentanwalt auf diesem Feld?

Dann ist dies das richtige Seminar für Sie! Vorkenntnisse im gewerblichen Rechtsschutz werden vorausgesetzt.

Ihre Referenten

Dr. Matthias Zigann

Vorsitzender Richter,
Landgericht München I,
7. Zivilkammer,
München

Dr. Oliver Pfaffenzeller

Lead IP Counsel,
Siemens AG,
München

Dr. Tobias Wuttke

Partner/Fachanwalt für
Gewerblichen Rechtsschutz,
Meissner Bolte,
München

Über Ihre Referenten

Dr. Matthias Zigann ist Vorsitzender Richter am Landgericht München I. Dort leitet er seit Dezember 2012 mit der 7. Zivilkammer eine der beiden Patentstreitkammern. Vorher war er dort sechs Jahre lang Beisitzer und weitere drei Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den X. (Patent) Senat des BGH abgeordnet.

Dr. Oliver Pfaffenzeller leitet bei Siemens ein IP Team im Bereich der Mittel- und Niederspannungsnetze. Er ist außerdem verantwortlich für das Reporting zum chinesischen Patentrecht innerhalb der Patentabteilung von Siemens.

Dr. Tobias Wuttke leitet die Prozessabteilung einer der führenden deutschen Kanzleien auf dem Gebiet des Patentrechts. Er ist seit über 10 Jahren auf Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsprozesse spezialisiert.

Ihr Programm im Überblick

26. März 2020, 09:00 bis 17:00 Uhr

Das Gebrauchsmusterverletzungsverfahren: der effizientere Patentverletzungsprozess?

Dr. Matthias Zigann

- Übersicht über das Gebrauchsmusterverletzungsverfahren
- Wie weit reicht der Schutzbereich?
- Welche Rolle spielt der Einwand fehlender Schutzfähigkeit?

Das Zusammenspiel von Patent- und Gebrauchsmusterverletzungs- prozess: welche strategischen Möglichkeiten ergeben sich hier?

Dr. Matthias Zigann, Dr. Tobias Wuttke

- Jedes Schutzrecht ein eigener Streitgegenstand
- Konzentrationsmaxime gem. § 145 PatG nicht anwendbar
- Sukzessive und parallele Angriffe

Gebrauchsmuster und einstweilige Verfügung: Düsseldorf, Hamburg, Mannheim, München? Die Besonderheiten der Standorte

Dr. Matthias Zigann, Dr. Tobias Wuttke

Die Abzweigung aus PCT/EP-Anmeldungen: welche Optionen bietet der (neue) Offenbarungsbegriff des BGH?

Dr. Tobias Wuttke

- Was bedeutet "unmittelbar und eindeutig" vor dem EPA und dem BGH?
- Mehrfache/wiederholte Abzweigungen - gibt es eine Grenze?

Das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren - Überraschungen vermeiden

Dr. Tobias Wuttke

- Voraussetzungen des erfolgreichen Löschantrags
- Löschantrag und parallele Amtsrecherche nach § 7 GebrMG?

Gebrauchsmuster in China: Worauf man sich einstellen muss und wie man dieses Instrument für eigene Zwecke nutzen kann

Dr. Oliver Pfaffenzeller

- Das chinesische Gebrauchsmuster als Waffe
- Notarisierung von Beweismitteln in China
- Anmeldestrategien für Erfindungen außerhalb Chinas

Deutsche und chinesische Gebrauchsmuster

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 2003170

Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

- Deutsche und chinesische Gebrauchsmuster
Webcode 2003170
- Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir
Informationen zu Veranstaltungen
 per E-Mail per Telefon übermitteln darf.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Termin/Veranstaltungsort:

Donnerstag, 26. März 2020 in München

09:00 bis 17:00 Uhr
Holiday Inn Munich-City Centre
Hochstr. 3 · 81669 München
Tel. +49 89 4803-4444 · Fax +49 89 4488-277

Gebühr:

€ 1.080,00 (+ gesetzl. MwSt.)

inkl. hochwertiger Dokumentation (auch zum
Download), Zertifikat, Arbeitsessen, Erfrischungen
und Kaffeepausen.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2016), die wir
auf Wunsch jederzeit übersenden und die im
Internet unter www.forum-institut.de/agb
eingesehen werden können.

IHR ANSPRECHPARTNER



Jean-Claude Alexandre Ho, LL.M.
Konferenzmanager
Tel. +49 6221 500-675
jc.alexandreho@forum-institut.de